

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2004-531879(P2004-531879A)  
 【公表日】平成 16 年 10 月 14 日 (2004.10.14)  
 【年通号数】公開・登録公報 2004-040  
 【出願番号】特願 2002-570011(P2002-570011)  
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/027

B 0 5 D 1/40

B 0 5 D 3/04

G 0 3 F 7/16

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 6 4 D

B 0 5 D 1/40 A

B 0 5 D 3/04 Z

G 0 3 F 7/16 5 0 2

【手続補正書】  
 【提出日】平成 17 年 2 月 15 日 (2005.2.15)  
 【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板の表面にコーティングする方法であって、  
 密閉ハウジング内に基板を装着し、  
 前記基板上に溶剤を含む溶液を付着させ、  
 前記ハウジングの雰囲気内に導入される溶剤の量を調整することにより、前記溶液からの溶剤の蒸発を制御し、

前記ハウジングの雰囲気内に導入される溶剤の量を調整することは、溶剤蒸気分圧が異なる複数のガスを混合して制御ガスを形成することにより、前記ハウジングの雰囲気内に導入される前記制御ガスの飽和の度合いを 0 % ~ 約 4 0 % の範囲内で調整することを含む、方法。

【請求項 2】

前記基板を回転させることを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記基板が可変速度で回転される、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記基板が、約 2 0 0 0 r p m 未満の回転速度で回転される、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 5】

前記基板が、当該基板上に 4 . 0 オングストローム ( 0 . 4 n m ) 以下の 1 シグマ膜均一性を可能とする十分な時間だけ回転する、請求項 2 に記載の方法。